## ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНОК ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА, ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНАМИ НИКЕЛЯ

А.С. Ким<sup>1)</sup>, М.Г. Лукашевич<sup>1)</sup>, В.Б. Оджаев<sup>1)</sup>, В.Ф. Валеев<sup>2)</sup>, Р.И. Хайбуллин<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Белорусский государственный университет,
пр. Независимости 4, Минск 220030, Беларусь,
kimandrej03@mail.ru, Lukashevich@bsu.by, Odzaev@bsu.by

<sup>2)</sup>Казанский физико-технический институт,
Сибирский тракт 10/7, Казань 420029, Россия,
valeev@kfti.knc.ru, rik@kfti.knc.ru

Исследованы оптические характеристики тонких (25 мкм) пленок полиэфирэфиркетона имплантированных ионами никеля с энергией 40 кэВ в интервале доз  $2.5 \times 10^{16} - 1.5 \times 10^{17}$  см $^{-2}$  при плотности ионного тока 4 мкА/см $^2$ . Интегральный коэффициент пропускания уменьшается в 8 раз, а отражения — в 3 и 2 раза от имплантированной и не имплантированной сторон. Узкая полоса отражения при  $\lambda = 315$  нм наблюдается от обоих сторон с интенсивностью в 5 раз ниже. С ростом дозы в отражении имплантированной стороной она смещается на  $\Delta\lambda = 20$  нм в коротковолновую область и на  $\Delta\lambda = 55$  нм в длинноволновую в отражении не имплантированной стороной. Обнаружена широкая полоса отражения при  $\lambda = 820$  нм, обусловленная образованием включений никеля, которая сдвигается в область длинных волн до  $\lambda = 2400$  нм с увеличением дозы.

Ключевые слова: пленка; полиэфирэфиркетон; имплантация; ион; никель; пропускание; отражение.

# OPTICAL PROPERTIES OF POLYESTERESTERKETONE FILMS IMPLANTED WITH NICKEL IONS

Andrei Kim<sup>1)</sup>, Mikhail Lukashevich<sup>1)</sup>, Vladimir Odzhaev<sup>1)</sup>, Valeri Valeev<sup>2)</sup>, Rustam Khaibullin<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Belarusian State University, 4 Nezavisimosti Ave., 220030 Minsk, Belarus
kimandrej03@mail.ru, Lukashevich@bsu.by, Odzaev@bsu.by

<sup>2)</sup>Kazan Physical-Technical Institute of RAS,
10/7 Sibirsky tract, 420029 Kazan, Russia,
valeev@kfti.knc.ru, rik@kfti.knc.ru

The optical properties of thin (25 microns) polyetheretherketone films implanted with Ni ions with an energy of 40 keV in the dose range of  $2.5 \times 101^6 - 1.5 \times 101^7 \text{ cm}^{-2}$  at an ion current density of  $4 \mu \text{A/cm}^2$  have been studied. The integral transmission coefficient is reduced by 8 times, and reflections — by 3 and 2 times from the implanted and non-implanted sides. A narrow reflection band at  $\lambda = 315 \text{ nm}$  is observed from both sides with an intensity 5 times lower. As the dose increases in the reflection of the implanted side, it shifts by  $\Delta\lambda = 20 \text{ nm}$  to the short-wavelength region and by  $\Delta\lambda = 55 \text{ nm}$  to the long-wavelength region in the reflection of the non-implanted side. A wide reflection band was found at  $\lambda = 820 \text{ nm}$ , due to the formation of nickel inclusions, which shifts to the region of long waves up to  $\lambda = 2400 \text{ nm}$  with increasing dose.

Keywords: film; polyetheretherketone; implantation; ion; nickel; transmission; reflection.

#### Введение

Имплантация низкоэнергетичных ионов металлов в полимерные пленки вследствие формирования на длине пробега ионов углеродных и металлических включений позволяет получать слои металло-полимерного композита с разными механизмами электронного транспорта и разным

магнитным состоянием. Такие наноструктурированные композиционные слои, полученные имплантацией ионов магнитных металлов, могут использоваться в магнитооптических устройствах с широким спектром применений вследствие формирования многослойной структуры с разными показателями преломления [1].

В данной работе представлены результаты измерения спектральных зависимостей пропускания и отражения пленок полиэфирэфиркетона (ПЭЭК), имплантированных ионами никеля.

## Методика эксперимента

Пленки ПЭЭК ( $C_{19}H_{12}O_{3}$ )<sub>п</sub> толщиной 25 мкм имплантировались при комнатной температуре однозарядными ионами никеля  $Ni^{+}$  с энергией 40 кэВ в интервале доз  $2.5 \times 10^{16}$  -  $1.5 \times 10^{17}$  см<sup>-2</sup> при плотности ионного тока 4 мкА/см<sup>2</sup> ионно-лучевым ускорителем ИЛУ-3

Спектры пропускания и отражения измерялись при комнатной температуре в диапазоне длин волн 200-3000 нм однолучевым спектрофотометром PHOTON-RT. Спектральные зависимости коэффициентов пропускания изучались при нормальном падении света, а отражения - при угле падения 8°. Спектральное разрешение было не хуже 0.5 нм, а погрешность измерения амплитуды не превышала ±0.5%.

## Результаты и их обсуждение

На рис. 1 показаны спектральные зависимости пропускания исходной и имплантированных пленок. Резкий край пропускания, обусловленный отсутствием поглощения света из-за возбуждения  $\pi$ -электронной системы полимера, наблюдается при  $\lambda = 354$  нм. В исходной пленке (кривая 1) в области прозрачности величина коэффициента пропускания близка к 80%, и он слабо зависит от длины волны.

Дозовая зависимость интегрального коэффициента пропускания показана на рис. 2. Имплантация приводит к уменьшению интегрального коэффициента пропускания в восемь раз, что обусловлено формированием в приповерхностном слое аморфных и графитоподобных углеродных включений, увеличением концентрации никеля и формированием его включений и включений его оксидов.

На рис. 3 (а) и (б) показаны спектральные зависимости отражения.

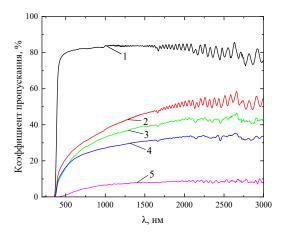


Рис. 1. Спектральная зависимость пропускания исходной (1) и имплантированных ионами никеля (2 - 5) пленок полиэфирэфиркетона. D, см<sup>-2</sup>: 2 - 2.5·10<sup>16</sup>; 3 - 1·10<sup>17</sup>; 4 - 1.25·10<sup>17</sup>; 5 - 1.5·10<sup>17</sup>.

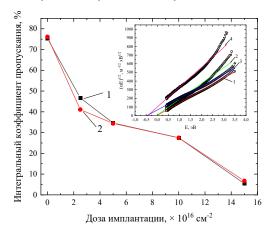
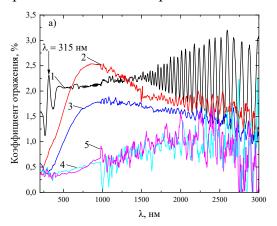


Рис. 2. Зависимость интегрального коэффициента пропускания пленок ПЭЭК от дозы имплантации

Имплантация приводит к изменению как величины, так и спектральной зависимости коэффициента отражения обоих сторон.

В исходной пленке наблюдается узкая полоса при  $\lambda=315$  нм и резкое увеличение отражения при  $\lambda=354$  нм, из-за дополнительного вклада в отражение не имплантированной стороны вследствие прозрачности пленки. Характерная для исходного образца полоса при  $\lambda=315$  нм в отражении имплантированной стороной не наблюдается при первых двух дозах, а при больших дозах она проявляется с интенсивностью в пять раз меньше. При этом ее положение смещается в область коротких длин волн на  $\Delta\lambda=20$  нм, а с не имплантированной стороной в область длинных волн на  $\Delta\lambda=55$ 

нм. Таким образом, комформационная перестройка надмолекулярной структуры полимера при имплантации может проходить в противоположных направлениях.



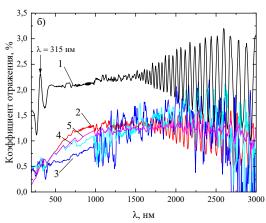


Рис. 3. Спектральная зависимость отражения исходной (1) и имплантированных (2-5) пленок ПЭЭК при падении света на имплантированную (а) и не имплантированную (б) стороны. D, см<sup>-2</sup>:  $2-2.5\cdot10^{16}$ ;  $3-1\cdot10^{17}$ ;  $4-1.25\cdot10^{17}$ ;  $5-1.5\cdot10^{17}$ 

Отметим также появление широкой полосы с максимумом при  $\lambda \approx 820$  нм, обусловленной формированием включений никеля [2]. С увеличением дозы она уширяется и смещается в сторону длинных волн. Сдвиг отражения в длинноволновую область может быть связан с неравномерным распределением размера формирующихся углерод- и никельсодержащих включений по толщине модифицированного слоя [3, 4].

Зависимость интегрального коэффициента отражения от дозы имплантации показана на рис. 4.

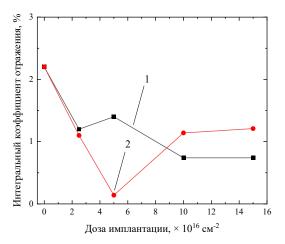


Рис. 4. Дозовая зависимость интегрального коэффициента отражения имплантированных пленок ПЭЭК при падении света на имплантированную (1) и не имплантированную (2) стороны

Немонотонная зависимость коэффициента отражения от дозы имплантации подтверждает завершение процессов карбонизации приповерхностного слоя при первой дозе и определяющее влияние никельсодержащей компоненты на оптические характеристики модифицированного слоя. Так представление спектральной зависимости пропускания в координатах Тауца (вставка на рис. 2) показало, что оптическая щель имеет отрицательный знак.

### Заключение

Интегральный коэффициент пропускания пленок ПЭЭК при имплантации ионов никеля уменьшается в восемь раз. Характерная для исходной пленки узкая полоса отражения при  $\lambda = 315$  нм в имплантированных пленках наблюдается как от не имплантированной, так и имплантированной сторон. В отражении имплантированной стороной она смещается на  $\Delta \lambda = 20$  нм в сторону коротких волн, а не имплантированной стороной на  $\Delta\lambda = 55$  нм в сторону длинных волн. Обнаружена широкая полоса отражения при  $\lambda = 820$  нм, смещающаяся до  $\lambda = 2400$  нм, обусловленная формированием включений никеля и неравномерным распределением его размеров по толщине модифицированного слоя.

## Библиографические источники

- 1. Бумай Ю.А., Долгих Н.И., Харченко А.А., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Хайбуллин Р.И. и др. Оптические характеристики композита, полученного имплантацией ионов серебра в полиэтилентерефталат. Журнал прикладной спектроскопии 2012; 79(5): 781-787.
- 2. Refractive Index Info. Доступно по: https://refractiveindex.info/ (дата обращения: 27.05.2025).
- 3. Townsend P.D., Chandler P.J., Zhang L. Optical effects of ion implantation. Cambridge: Cambridge University Press; 1994.
- 4. Stepanov A. L, Hole F.E., Townsend P.F. Reflectance of the dielectric layers containing formed by ion implantation. *Journal of Non-Crystalline Solids* 1999; 244: 275-279.